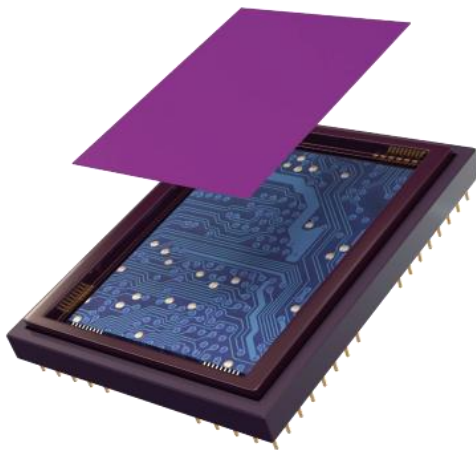




紫外到红外 CCD 或 CMOS 器件镀膜服务

(UVIR 磷光体涂层)



总览

我们基于磷光体的闪烁体的高灵敏度将相对低成本的设备转变为可根据您的要求定制的高性能传感器。

产品特点

- ☀ 将设备的光谱灵敏度扩展到紫外线和红外线范围
- ☀ 紫外线和红外线应用
- ☀ 特定波长荧光粉
- ☀ 高性能
- ☀ 适用于多种应用的经济高效的紫外和红外检测方法
- ☀ 低噪声

产品应用

☀ CCD 或 CMOS 器件

使用直接施加在 CCD 或 CMOS 设备上的基于磷光体的涂层构建，这些涂层将设备的灵敏度从可见光范围扩展到紫外线或红外线。

我们的制造工艺使我们能够将涂层一直延伸到所需活性区域的边缘，为光谱、生物成像、材料研究以及电信设备制造和测试等应用提供 z 佳成像解决方案。

我们的专业磷光体涂层专为扩展光谱响应而定制，可提供低噪声、z 佳成像和高性能检测解决方案。

☀ 光纤板

我们的涂层还可以应用于光纤板或其他无源元件，以满足客户在 IR 或 UV 中的特定应用





通用参数

UV 涂覆层

BAMb - 一般为 240-400nm 的短紫外荧光粉，在 460nm 有吸收和蓝色峰值发射。

BAMg - 一般为 240-400nm 的短紫外荧光粉，在 520nm 处有吸收和绿色峰值发射

GOrg - 强效紫外荧光粉，具有 150-400nm 吸收能力，并在 545nm 处具有绿色峰值发射

P43 - 硫氧化钆荧光粉的吸收率 <300nm，在 545nm 处具有绿色峰值发射

IR 涂覆层

VisIR

一种反斯托克斯荧光粉，具有宽带激发和 560/900nm 峰值发射（取决于激发），无需充电。

VisE

一种具有宽带发射（峰值 660nm）的存储荧光粉，需要用紫外光或蓝光充电。

荧光粉涂覆层	激发波长 (Excitation)	发射 (Emission)	中值粒径 (Median particle size)	衰减时间为 10% (Decay time to 10%)
BAM b	240-400nm	460nm	4-5μm	3μs
BAM g	240-400nm	520nm	4-5μm	0.8μs
GOrg	150-400nm	545nm	~10μm	2.6ms
P43	10-300nm	545nm	4μm	1.5ms
VisE	800 -1600nm	660nm	5μm - 9μm	85ns
VisIR	800, 1100, 1550nm	560/900nm	5μm - 9μm	取决于过程

定制化解决方案

我们采用一系列不同的涂层方法来适应客户系统的特定设备 and 应用。 我们灵活的制造设施使我们能够为客户提供小批量和大批量生产的一致质量。